(19) **日本国特許庁(JP)**

(12) 特許公報(B2)

(11)特許番号

特許第5124666号

(P5124666)

(45) 発行日 平成25年1月23日(2013.1.23)

(24) 登録日 平成24年11月2日 (2012.11.2)

(51) Int.Cl.			FΙ		
GO2B	6/122	(2006.01)	GO2B	6/12	Α
GO2B	6/30	(2006.01)	GO2B	6/30	

請求項の数 7 (全 9 頁)

(21) 出願番号	特願2011-81371 (P2011-81371)	(73)特許権者	f 596092698
(22) 出願日	平成23年4月1日(2011.4.1)		アルカテルールーセント ユーエスエー
(62) 分割の表示	特願2005-5798 (P2005-5798)		インコーポレーテッド
	の分割		アメリカ合衆国 07974 ニュージャ
原出願日	平成17年1月13日 (2005.1.13)		ーシィ, マレイ ヒル, マウンテン アヴ
(65) 公開番号	特開2011-170368 (P2011-170368A)		±=1− 600-700
(43) 公開日	平成23年9月1日(2011.9.1)	(74)代理人	100094112
審査請求日	平成23年4月1日(2011.4.1)		弁理士 岡部 讓
(31) 優先権主張番号	10/756522	(74)代理人	100104352
(32) 優先日	平成16年1月13日 (2004.1.13)		弁理士 朝日 伸光
(33) 優先権主張国	米国 (US)	(72)発明者	クリスティ ケイ マドセン
			アメリカ合衆国 07080 ニュージャ
			ーシィ,サウス プレーンフィールド,ジ
			ョーン ストリート 436
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】光ファイバとプレーナ光導波路とを高密度に結合する方法及び装置

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

光ファイバをプレーナ導波路に光結合するための結合デバイスであって、

前記プレーナ導波路に結合されるプレーナ導波路コア上に配置されたセグメント化され た導波部分を備える光導波構造を備え、該セグメント化された導波部分がクラッディング 領域に配置され、該クラッディング領域の材料の屈折率よりも高い屈折率の材料からなり

前記セグメント化された導波部分が一連の離隔されたセグメントからなり、該セグメントの各々が前記光ファイバのファイバコアの光軸垂直断面と同等の大きさの光軸垂直断面 を有し、該一連の離隔されたセグメントが、該光ファイバからの光に対して、該光が前記 プレーナ導波路に向けて伝搬するにつれて該プレーナ導波路の有効屈折率に増加的に近づ く有効屈折率を呈するように、該ファイバコアに隣接するセグメントから該ファイバコア から最も遠いセグメントに向けて減少する厚さを有する、結合デバイス。

10

【請求項2】

光ファイバをプレーナ導波路に光結合するための結合デバイスであって、

セグメント化された導波部分を備える光導波構造を備え、該セグメント化された導波部 分が一連の離隔されたセグメントからなり、該セグメントの少なくとも一部が第1の屈折 率の第1の材料及び第2の屈折率の第2の材料からなり、該第1の屈折率が該光ファイバ の屈折率に適合し、該第2の屈折率が該プレーナ導波路の屈折率に適合するとともに該第 1の屈折率よりも高く、該第2の屈折率からなるセグメントの部分が該プレーナ導波路の 寸法に一致するまで徐々に増加するものであり、

該一連の離隔されたセグメントが該ファイバコアに隣接するセグメントから該プレーナ 導波路に最も近いセグメントに向けて減少する光軸垂直断面積を有するとともに、該一連 の離隔されたセグメントが、該光ファイバからの光に対して、該光が前記プレーナ導波路 に向けて伝搬するにつれて該プレーナ導波路の有効屈折率に増加的に近づく有効屈折率を 呈するように、該ファイバコアに隣接するセグメントから該プレーナ導波路に最も近いセ グメントに向けて増加する厚さを有する、結合デバイス。

【請求項3】

請求項2記載の結合デバイスにおいて、該ファイバコアが該プレーナ導波路コアよりも 大きい断面積を有する結合デバイス。

【請求項4】

請求項1又は2記載の結合デバイスにおいて、該プレーナ導波路が4%以上の高デルタ コアを有する結合デバイス。

【請求項5】

請求項1又は2記載の結合デバイスにおいて、該プレーナ導波路が6%以上の高デルタ コアを有する結合デバイス。

【請求項6】

請求項1又は2記載の結合デバイスにおいて、該光導波構造がプレーナ導波路を含む集 積光デバイスにおいて配置された結合デバイス。

【請求項7】

請求項1又は2に記載の結合デバイス、及び該結合デバイスによってプレーナ導波路に 結合される前記光ファイバを備えた光デバイス。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

[0001]

本発明は光を光ファイバからプレーナ導波路及びその逆に高密度かつ高効率に結合する ための方法及び装置に関する。

【背景技術】

[0002]

プレーナ導波路デバイスは光ファイバ通信システムにとって重要な部材である。通常、 そのようなシステムは伝送のための長距離のファイバからなるとともに、フィルタリング 、信号チャネルの多重化、多重化の解除、色彩分散の補償及び極性分散の補償のような種 々の処理を行うためのプレーナ導波路デバイスを用いることが多い。

[0003]

光ファイバは通常、周囲を同心円状のクラッディングガラスで覆われた円形断面の中心 コアを有するガラスの薄い撚り線の形状をとる。コアはクラッディングよりも高屈折率を 有するので光は全反射してコア内にとどまり、ファイバモードにおいて伝搬する。長い距 離の伝送のため、コアの寸法は通常、光が単一のサーキュラーモード(single circular m ode)において伝搬するように選ばれる。

[0004]

それに対し、プレーナ導波路デバイスは通常、シリコン基板によって支持されたシリカ の薄膜によって形成される。通常、コアは長方形の断面である。コア領域は、マスクされ た表面のエッチング等によって、所望の機能を発揮するパターン化された構成に形成され る。小さい半径の曲げ及びこれによる高密度な機能性を許容するため、プレーナ導波路コ アの屈折率とクラッディング屈折率の差は、通常光ファイバにおける対応する差よりも実 質的に大きい。プレーナ導波路は高デルタであるといわれている。ここで、デルタ() はクラッディングの屈折率よりもコアの屈折率によって与えられ、コアの屈折率で分配さ れている。

【 0 0 0 5 】

しかしながら、光を伝送ファイバからプレーナ導波路に結合するにあたって問題が生ず 50

10

20

30

る。屈折率の不整に加えて、コアサイズにも不整がある。通常の光ファイバのコアサイズ は単一モードプレーナ導波路の最適サイズよりも充分大きい。それゆえ、領域はファイバ 内よりも導波路内の方においてより閉じているので、それらの光モードは一致しない。こ れらの不整の結果、ファイバからプレーナ導波路への直接の結合は光ビームの抑制的な挿 入損失を招くことになる。

(3)

【0006】

この問題に対する従来の手法は、ファイバを受けるための広げられた終端を持つプレー ナ導波路を用いて、導波路コアを横方向に最適サイズにまで徐々に(断熱的に)テーパー 化するものである。横方向のテーパーは導波路の光回路と同じ面上にある。この手法は挿 入損失を低減するが、あいにく断熱的な横方向のテーパー化が高デルタ導波路のために効 率的でなく、相当の長さが必要となる。

【0007】

処理をより工夫する手法は、ファイバ終端の拡張された高さの導波路に始まり、導波路 回路レベルまで垂直方向にテーパーの高さを落としていくものである。この技術は、Koch 他によって提案された("Tapered Waveguide InGaAa/InGaAsP Multiple-Quantum-well L asers", T.L.Koch, IEEE Photonics Letters 第12巻,第2号, 1990年2月; また、A. Maha patra、J. M. Connorsによる"Thermal tapering of ion-exchanged channel guides in glass", Opt. Letters, 第13巻, 第169-171ページ, 1988年,及びShani他による"Eff icient coupling of semiconductor laser to an optical fiber by means of a tapered waveguide on silicon", Applied physics Letters 55(23), 1989年12月)。しかし、 この場合、成長させるのに非常に長い時間を要するようなコア高さで始まる相当の長さの 導波路が必要となる。

20

10

[0008]

2次元でテーパー化されセグメント化された導波路はZ. Weissman及びA. Hardyによっ て実証された。この技術は、導波路のセグメント間のギャップを導入することにより2次 元モードテーパー化を実現するものである。(Z. Weissman及びA. Hardy, "Modes if Pe riodically Segmented Waveguide" IEEE Journal of Lightwave Technology 11:1831-18 38 (1993年))。 実際、導波領域の全有効屈折率は低減する。この手法は結合損失を低減 するのに非常に有効である。しかし、高屈折率の導波路のために、コアの厚さがファイバ と比較して小さくなり、それゆえ、セグメント化されたテーパーを介したモードの一致性 を得るのが難しく、まだファイバモードとの一致性の方が良い。

30

従って、光ファイバからプレーナ導波路に伝搬する光を高密度で高効率に結合するため の改良された構成が必要とされている。

【発明の概要】

[0009]

【課題を解決するための手段】

[0010]

本発明によると、光ファイバがプレーナ導波路に(1)拡大された断面の一連のプレー ナ導波路セグメント、及び(2)テーパー状の断面のセグメントを介して結合される。離 隔されたセグメントとテーパー状のセグメントとの組み合わせが、従来の断熱的結合で必 要とされていたよりも大幅に短縮された長さでの効率的な結合を提供する。

40

【0011】

本発明の利点、性質及び種々の追加的な事項は、付随する図面に関連してその詳細が説明される実施形態を読めばより明確になる。

【図面の簡単な説明】

【0012】

【図1】図1は本発明によるプレーナ導波路デバイスに結合された光ファイバの概略説明 図である。

【図2】図2は図1の結合構成の第1の例を模擬的に示す図である。

【図3】図3は図1の結合構成の第2の例を模擬的に示す図である。

【図4】図4は、テーパー領域が連続的というよりも段階的にテーパー化された結合構成の例を模擬的に示す図である。

【図5】セグメントがプレーナ路上にある異なる屈折率の2つの材料からなる結合構成の 代表的側面図を模擬的に示す図である。

【図 6】テーパー化されセグメント化された部分が、異なる屈折率の 2 つの材料からなる 結合構成の代表的側面図を模擬的に示す図である。 これらの図面は本発明の概念を模擬 的に図示するためのものであり、グラフを除き、実寸法ではないことが理解されるべきで ある。

【発明を実施するための形態】

【0013】

10

20

図面を参照すると、図1は本発明の一実施形態によるプレーナ導波路デバイス11に結 合された光ファイバ10からなるデバイス9の概略説明図である。具体的には、デバイス 9は直径dのコア12を有する少なくとも1つの光ファイバ10、及びファイバコア12 の直径よりも小さい各横方向寸法(高さh、幅w)のコア13を有し軸方向に延びる少な くとも1つのプレーナ導波路11を含む。ファイバコア12は、伸長した横方向断面のセ グメント化された導波路部分14及びテーパー化された部分15によって、より小さい導 波路コア13に結合される。セグメント部分14は好ましくはファイバコア12とほぼ同 じ横方向断面を有し、コア12からの初段の結合をできるようにする。セグメントの厚さ 及び/又はセグメントの間隔は、低屈折率のファイバコアから離れる光が高屈折率のプレ ーナ導波路コア付近まで徐々に増加する有効コア屈折率に遭遇するように、ファイバから プレーナ導波路にかけて変化する。これにより、セグメント部分14からテーパー部分1 5の拡張された領域の端部16にかけての最小の屈折率不整をもって結合できる。テーパ ー部分は、より小さい横方向断面のプレーナ導波路コア13付近までテーパーの高さを落 としていく。導波路コア13は、結合された光を処理するための(図示されない)幾何学 的配置、他のコア、位相シフター、又はリング共振器によって構成される。

【0014】

図1の結合デバイスは光ファイバの一部分という形で又はプレーナ導波路を含む集積された光デバイスの部分として実施することができる。

【0015】

同様に、プレーナ導波路デバイスからの光は、プレーナ導波路からファイバまでを通過 30 することにより高効率かつ高密度に光ファイバに結合される。光は逆方向にテーパー部分 15から拡張部分16にかけても通過する。そして、それはセグメント部分14から光フ ァイバの端部と一致する低有効端部にかけて結合する。

【0016】

縦方向テーパーのセグメント化された部分はシリコン光微細加工技術において使用され る標準的な技術を用いて製作できる。まず、低クラッディング層が低圧蒸気酸化処理とそ の後のアニールによって形成される。そして、高屈折率のコア層がプラズマ・エンハンス ト・蒸着(PECVD)によって、又は低圧化学蒸着(LPCVD)によって配置され、 ガラスを流すためにアニールされる。そして、セグメント化された導波路は、クロムマス クコンタクトを用いて1:1のプロジェクションでのフォトリソグラフィによってパター ン処理される。そして、マスク情報が反応性イオンエッチングを用いてコアにパターン処 理される。ポリシリコン混合物又はハードベークされた(hard baked)フォトレジストが この処理で使用される。0.7から32.5µmの範囲のギャップサイズが達成される。 次に、クラッディング層がガラスを流すためのアニールによるいくつかの工程において定 着される。

【0017】

シャドウ又はディザーのマスクが構造の縦方向にテーパー化された部分をパターン処理 するのに使用される。これらのマスクによって可変の光強度の伝送が可能となる。フォト レジストが高い光強度に曝される領域はより早く成長する。コア材料のエッチングスピー ドはどれだけレジストが成長したかに関係し、それゆえ、異なる高さの領域が製作される 40

【0018】

代替の実施形態では、テーパー部分15が図1に示すような連続的テーパーではなく、 図4に示すように段階的テーパーとなっている。この手法の利点は製作が容易であること である。しかし、少ないステップ数が用いられると、損失の増大を招く高次のモードが誘 発される。

【0019】

図5に示すように、他の代替の実施形態では、結合器構造は光をファイバからプレーナ 光波回路(PLC)チップに結合するための2つの層からなる。屈折率n1のセグメント は屈折率n2のプレーナ導波路52に接触して配置される。コア51(n1)は光をファ イバから結合機のチップに効率的に結合する厚く低屈折率の材料である。コア52(n2))はPLCデバイスと同じ材料の高屈折率のコアである。光は効率的にn1及びn2のコ アに結合される。ここでは、低屈折率のコアはギャップとともにセグメント化されている 。ギャップサイズはPLCチップに向かって増加し、それゆえ、低屈折率のコアの有効屈 折率は徐々に減少する。結果として、光は断熱的に高屈折率のコアに結合される。(PL Cチップ付近の)終端の幅は導波路の単ーモードサイズにまで狭められる。

【0020】

図6に示すように、さらに他の代替の実施形態では、種々の高さのセグメントがファイ バ12からプレーナ導波路62にかけてテーパー化されている。セグメント61は2つの 材料からなり、一方の屈折率n1はファイバに適合し、他方の屈折率n2はプレーナ導波 ²⁰ 路の屈折率に適合する。屈折率n2からなるセグメントの部分はプレーナ導波路62の寸 法に一致するまで徐々に増加する。

【0021】

以下の例において、セグメントの寸法及び特にセグメントの厚さがプロメテウス(Prometheus)を用いて決められる。プロメテウスとは導波路シミュレーション及びデバイス最適化のための標準的技術を用いる3次元差分ビーム伝搬コンピュータプログラムである。 プロメテウス・パッケージ(正式にはBBV Software, The Netherlands)は「OlympIOs」 の一部である。OlympIOsは市販されている光学ソフトウエアパッケージであり、2次元有 効屈折率ビーム伝搬法と同様にプロメテウスからなる。(C2V、私書箱318、7500AH、Ensc hede、The Netherlands)。本発明は以下の特定の例を考察してより明確に理解できる。 【0022】

例1:

図2は、1.9×1.9µmの高い6%デルタのプレーナ導波路とともに8µmのコア を有する光ファイバを結合するための構成を模擬的に図示するものである。セグメント部 分14はファイバコアからテーパー部分15に結合される10個の高デルタ部分からなる 。各セグメントは8×8µmの断面を有し、連続するセグメントは周期的に(中心間が) 8µm離れている。ファイバからの光が連続する高デルタテーパー部分に近付くにつれて 増大する有効屈折率を通過するように、連続するセグメントはファイバからテーパー部分 にかけて長さ方向に増大する厚さを有する。テーパー部分は110µmの長さの非テーパ ー部及び250µmの非テーパー部並びにプレーナ導波路の寸法まで高さを落とす250 µmの線形テーパー領域を含む。結合損失は入力セグメントから線形テーパーの始端まで 約0.25dBである。断熱テーパーの損失は長さと形状に依存する。

```
40
```

30

10

例2:

光ファイバを4% デルタのプレーナ導波路に結合するため、図3に示す同様の構成とし て周期的に9μm隔てられた7×7μmのセグメントとすることができる。全結合損失は 約0.18dBである。

【0024】

[0023]

例 3 :

図4は連続的テーパーというよりは段階的にテーパー化されたテーパー部分15を用い 50

る構成を模擬的に図示するものである。ここでは、10個の7×7µmのセグメントを用 いて(図示されない)ファイバから段階的テーパー部分15にかけて結合するものである 。部分15はテーパーの高さを10個の各25µmの段について0.43µm落としてい る。4%デルタのプレーナ導波路に結合するため全結合損失は約0.35dBである。 【0025】

本発明は光ファイバをプレーナ導波路に光結合するためのデバイスを含むことが分かる 。デバイスはセグメント化された導波部分及びテーパー化された導波部分からなる導波構 造からなり、両導波部分はファイバとプレーナ導波路間の低屈折率のクラッディング領域 に配される。

[0026]

ントからなる。

10

20

30

セグメント化された導波部分は高屈折率材料の一連の離隔されたセグメントからなる。 セグメントはファイバコアの断面にほぼ等しい長さ方向の断面を有し、連続するセグメントは、ファイバコアの有効屈折率付近からプレーナ導波路の有効屈折率付近にかけて変化 する有効屈折率を呈するために、増大する軸方向の厚さを有する。

[0027]

テーパー化された導波部分はセグメント化された導波部分付近の断面からプレーナ導波 路コア付近の断面にかけて変化する長さ方向の断面を有する。テーパーは連続的であって も段階的であってもよい。

[0028]

例4:

図5はコア51及び52からなる2層化アプローチを用いる構成を模擬的に図示するものである。ここで、ファイバコア12からの光は高さ2.7µmで幅8.0µmの寸法の プレーナ導波路に結合される。10個のセグメントが用いられファイバからコア51を介 してコア52に結合される。

【0029】

例 5 :

図6は、セグメントがn1及びn2の屈折率の2つの材料からなる構成を模擬的に図示 するものであり、ここでn2>n1である。10個のセグメント61が用いられファイバ 12からプレーナ光導波路63にかけて光を結合する。(セグメントの数は屈折率によっ て10から30の間で変えることができる。)セグメント61はファイバ12からプレー ナ導波路62にかけて増大する厚さを有する。さらに、セグメント61はプレーナ導波路 方向に増加するn2材料の部分からなる。プレーナ導波において、最後のセグメントにお けるn2材料の寸法はプレーナ導波路62の寸法、ここでは2.7µm×8µm、に一致 する。

[0030]

なお、上記の実施形態は、数ある可能な特定の実施形態のうち本発明の応用例を代表す るほんのわずかを図示したに過ぎない。当業者であれば多くの他の変更例は本発明の精神 と範囲から逸脱することなく想到可能である。

【符号の説明】

- 【 0 0 3 1 】
- 9 デバイス
- 10 光ファイバ
- 11 プレーナ導波路
- 12 ファイバコア
- 13 導波路コア
- 14 セグメント部分
- 15 テーパー部分
- 16 端部
- 51、52 導波路コア
- 61 セグメント部分

40

50

6.2 プレーナ導波路

















フロントページの続き

(72)発明者 マーマウド ラスラス アメリカ合衆国 07974 ニュージャーシィ,ニュー プロヴィデンス,ゲイルズ ドライヴ 29,アパートメント 1

審査官 吉田 英一

(56)参考文献 特開平08-262245(JP,A) 特開2004-240064(JP,A) 国際公開第02/005000(WO,A1) 特開平07-110415(JP,A) 特開2003-207684(JP,A) 特開平11-160556(JP,A) 特開2002-14243(JP,A) 特開2001-337252(JP,A) 特開2001-305366(JP,A) 特開平6-313817(JP,A) Z. Weissman and I. Hendel, Analysis of Peression

Z. Weissman and I. Hendel, Analysis of Periodically Segmented Waveguide Mode Expanders, JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY, 1995年10月, Vol. 13, No. 10, pp. 2053 - 2058 日景正広、千葉貴史、上塚尚登,高 石英導波路用分割導波路型スポットサイズ変換器,200 2年電子情報通信学会エレクトロニクスソサイエティ大会講演論文集1,日本,社団法人電子情 報通信学会,2002年 8月20日, pp. 169

M. H. Chou, M. A. Arbore, and M. M. Fejer, Adiabatically tapered periodic segmentation of channel waveguides for mode-size transformation and fundamental mode excitation, 0 ptics Letters, 1996年 6月 1日, Vol. 21, No. 11, pp. 794 - 796

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

G 0 2 B 6 / 1 2 2 G 0 2 B 6 / 3 0 J S T P l u s (J D r e am I I) J S T 7 5 8 0 (J D r e am I I)